

ПОЗИТИВНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ AR-813

Это универсальный позитивный фоторезист g-line.

Высокая светочувствительность, высокое разрешение, хорошая термостойкость и устойчивость к сухому травлению.

Широкий допуск и применение.

Используется безопасный растворитель (ацетат монометилового эфира пропиленгликоля, PGMEA).

Широкий допуск к дозе облучения и глубине фокусировки.

Высокое разрешение до 0,5 мкм.

Прямая боковая стенка.

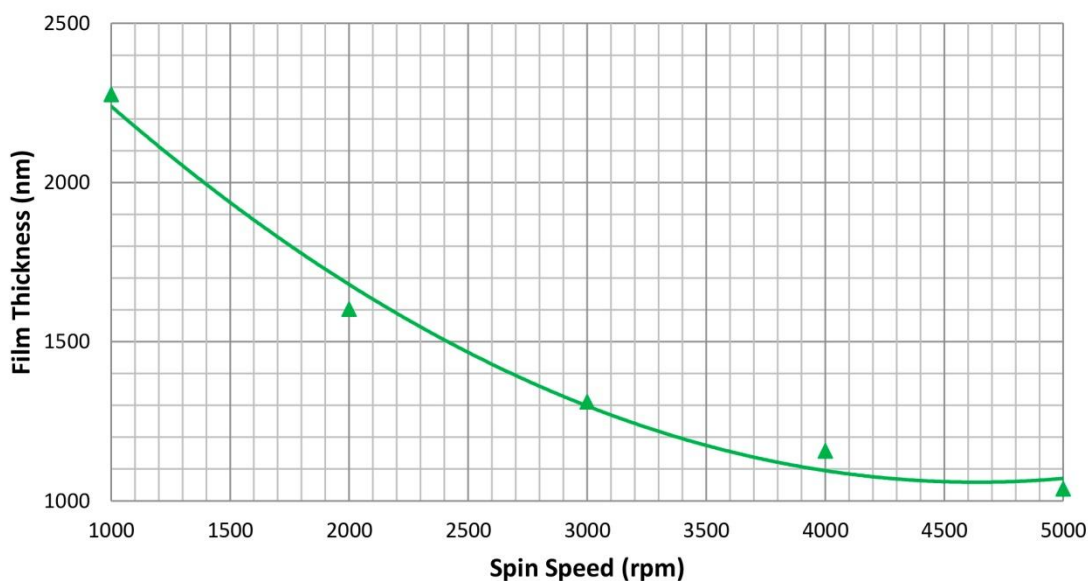
Простота в применении.

Термостойкость.

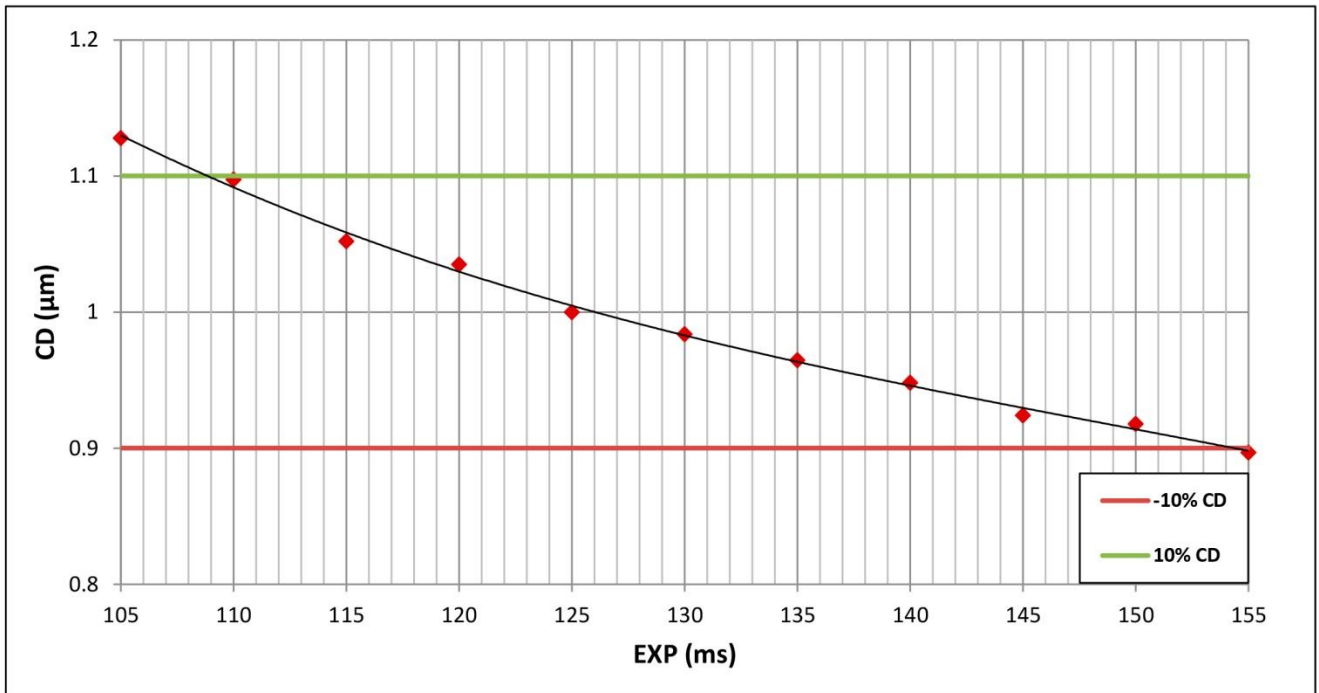
Спецификация:

Скорость вращения при нанесении, rpm	3000
Толщина плёнки, мкм.	1,3
Вязкость кинематическая, при температуре 25 град. цельсия	Вязкость 25°C, cSt – 15 ± 1
Применяемый проявитель	2.38% TMAH, 60 сек. 25°C
Сушка	90°C, 60 сек, 115°C, 60sec
Экспонирование	50~80 mj/cm ² i-line; 100~140mj/cm ² g-line

Толщина при нанесении:

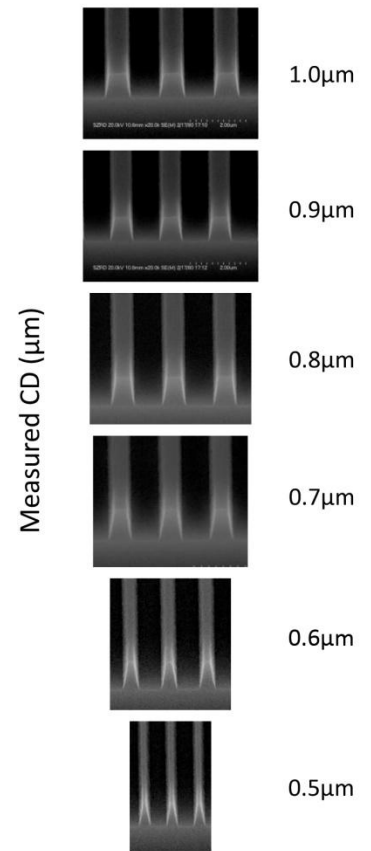
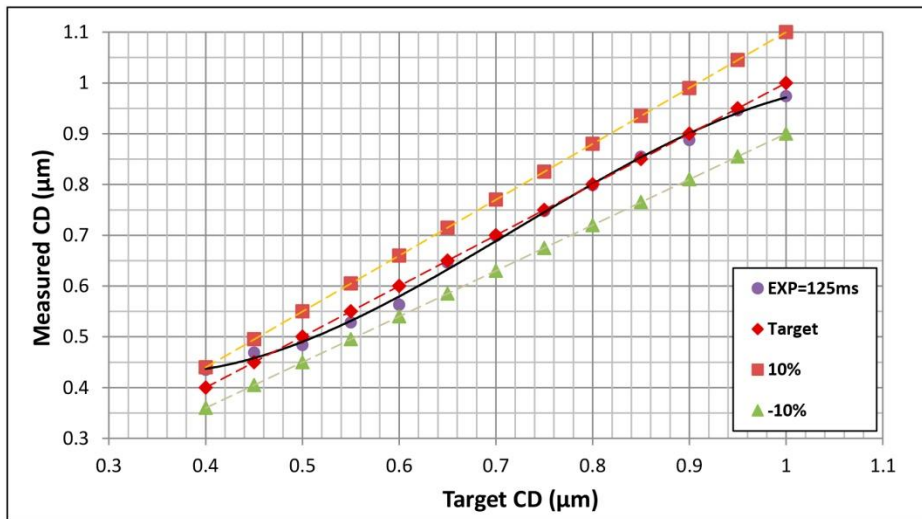


Экспонирование: (EL=36%, CD1.0µm Dense L/S)



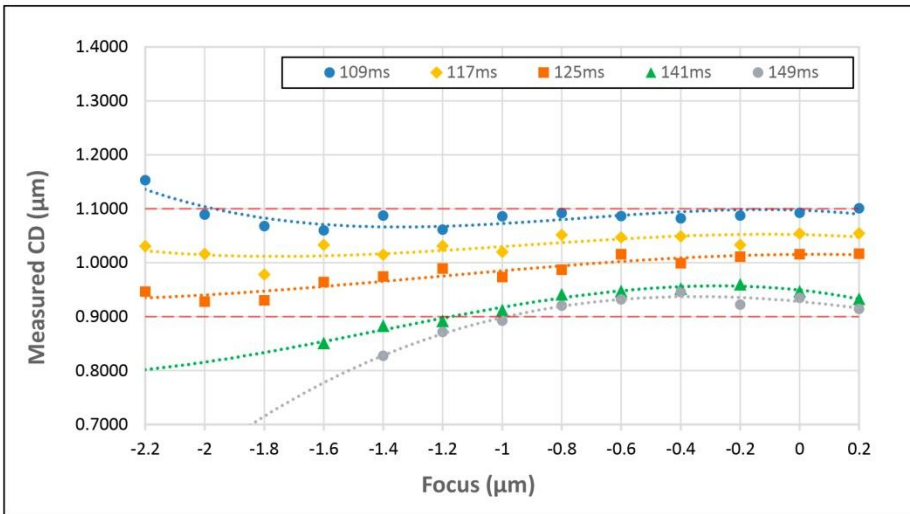
- Soft Bake: 90°C, 60 sec, Hot Plate
- FT: 1.20µm, Target CD=1.0µm Dense L/S
- Exp: i-line Stepper
- PEB: 115°C, 60 sec, Hot Plate
- Dev: 2.38% TMAH, 60 sec, Puddle

CD Linearity

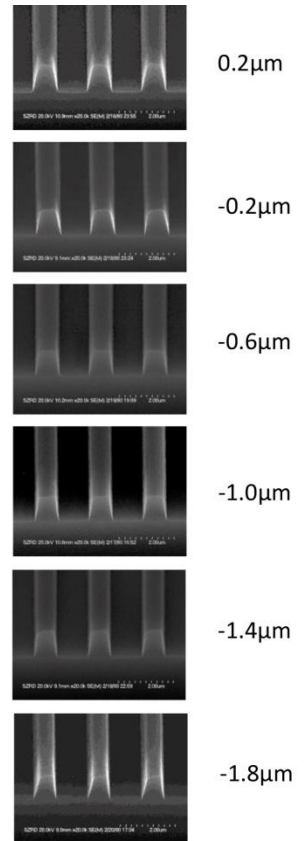


- Soft Bake: 90°C, 60 sec, Hot Plate
- FT: 1.20µm
- Exp: i-line Stepper, EXP=125ms, Focus=0µm
- PEB: 115°C, 60 sec, Hot Plate
- Dev: 2.38% TMAH, 60 sec, Puddle

Depth of Focus



Focus (µm)



- Soft Bake: 90°C, 60 sec, Hot Plate
- FT: 1.20µm, Target CD=1.0µm Dense L/S
- Exp: i-line Stepper, EXP=125ms
- PEB: 115°C, 60 sec, Hot Plate
- Dev: 2.38% TMAH, 60 sec, Puddle

Условия хранения и применения:

Хранить в закрытом оригинальном контейнере.

Защищайте от солнечного света.

Хранить в прохладном и сухом помещении.

Рекомендуется постоянная температура от 5 до 25 °C.

Применение при желтом освещении.

Срок годности при соблюдении условий хранения 12 месяцев от даты производства.